

Табл. 1. — Энергия связи различных атомов и электрона

Атом	EA, эВ	Атом	EA, эВ
1 H	0,75416	37 Rb	0,4859
3 Li	0,609	39 Y	0,307
5 B	0,277	40 Zr	0,426
6 C	1,269	41 Nb	0,893
7 N	нет	42 Mo	0,746
8 O	1,46112	43 Tc	0,5
9 F	3,399	44 Ru	1,05
11 Na	0,5479	45 Rh	1,137
13 Al	0,441	46 Pd	0,557
14 Si	1,385	47 Ag	1,302
15 P	0,7465	49 In	0,3
16 S	2,07712	50 Sn	1,2
17 Cl	3,617	51 Sb	1,07
19 K	0,501	52 Te	1,9708
21 Sc	0,188	53 I	3,0591
22 Ti	0,079	55 Cs	0,47163
23 V	0,525	57 La	0,5
24 Cr	0,666	73 Ta	0,322
25 Mn	нет	74 W	0,815
26 Fe	0,163	75 Re	0,15
27 Co	0,661	76 Os	1,14
28 Ni	1,156	77 Ir	1,56
29 Cu	1,228	78 Pt	2,128
31 Ga	0,30	79 Au	2,3086
32 Ge	1,20	81 Tl	0,2
33 As	0,81	82 Pb	0,364
34 Se	2,0207	83 Bi	0,946
35 Br	3,365	84 Po	1,9

Приимечание. Несуществующие отрицательные ионы инертных газов и щёлочноzemельных металлов не включены в таблицу.

Двухзарядные О. и. не существуют. В редких случаях О. и. могут иметь метастабильные возбуждённые состояния. В табл. 2 приводятся EA для основного и возбуждённого состояний тех О. и., у к-рых имеются возбуждённые состояния.

Табл. 2. — Энергия связи в основном и возбуждённом состояниях

Отрицательный ион, состояние	EA, эВ	Отрицательный ион, состояние	EA, эВ
C ⁻ (¹ S)	1,269	Ge ⁻ (¹ S)	1,2
C ⁻ (² D)	0,033	Ge ⁻ (² D)	0,4
Al ⁻ (³ P)	0,441	Y ⁻ (¹ D)	0,307
Al ⁻ (¹ D)	0,109	Y ⁻ (³ D)	0,164
Si ⁻ (¹ S)	1,385	Pd ⁻ (² S)	0,557
Si ⁻ (³ D)	0,523	Pd ⁻ (² D)	0,421
Si ⁻ (² P)	0,029	Sn ⁻ (¹ S)	1,2
Sc ⁻ (¹ D)	0,188	Sn ⁻ (² D)	0,4
Sc ⁻ (³ D)	0,041		

Если О. и. содержит два возбуждённых электрона, то такое состояние является автораспадным. Короткоживущие ($\sim 10^{-4}$ с) автораспадные состояния О. и. проявляются в процессах столкновения электронов с атомами. Напр., существование автораспадного состояния О. и. азота повышает эффективность излучения низкотемпературной азотной плазмы.

Молекулярные О. и. представляют собой связанное состояние молекулы и электрона. Энергии сродства нек-рых молекул к электрону приведены в табл. 3.

Табл. 3. — Энергия связи электрона с молекулой

Молекула	EA, эВ	Молекула	EA, эВ
Br ₂	2,6	NO ₂	3,1
Cl ₂	2,4	O ₃	2,1
F ₂	3,0	SH ₂	1,1
I ₂	2,5	SO ₂	1,0
O ₂	0,44	CO ₂	2,8
OH	1,83	NO ₃	3,7
S ₂	1,66	CO ₄	1,2

Особенно эффективно они образуются в электроотрицат. газах при низких темп-рах. Наличие автораспадных состояний молекулярных О. и. увеличивает эффективность коле-

Табл. 4. — Разрушение и образование отрицательных ионов

Процесс	Пример
1. Диссоциативное прилипание электрона к молекуле	e + H ₂ → H ⁻ + H
2. Прилипание электрона к молекуле при тройных столкновениях	e + 2O ₂ → O ₂ ⁻ + O ₂
3. Радиац. прилипание электрона к атому и молекуле	e + H → H ⁻ + h ω
4. Хемионизация	Cs + MoF ₆ → Cs ⁺ + MoF ₆ ⁻
5. Резонансная перезарядка	H ⁻ + H → H + H ⁻
6. Нерезонансная перезарядка	O ₂ ⁻ + O ₂ → O ₂ + O ₂ ⁻
7. Ионно-молекулярные реакции	UF ₆ + BF ₃ → UF ₅ + BF ₄ ⁻
8. Образование кластерных ионов	OH ⁻ + H ₂ O + O ₂ → OH ⁻ · H ₂ O + O ₂
9. Фотодиссоциация	CO ₃ ⁻ · H ₂ O + h ω → CO ₂ ⁻ + H ₂ O
10. Фотораспад	H ⁻ + h ω → H + e
11. Взаимнаянейтрализация ионов	H ⁺ + H ⁻ → 2H
12. Рекомбинация ионов при тройных столкновениях	NO ⁺ + NO ₃ ⁻ + N ₂ → NO + NO ₂ + N ₂
13. Ассоциативный распад	O ⁻ + CO → CO ₂ + e
14. Разрушение О. и. при столкновениях	H ⁻ + He → H + He + e

бательного возбуждения молекул в разряде на неск. порядков.

Процессы разрушения и образования О. и. очень разнообразны (табл. 4). Эффективностью этих процессов определяется роль О. и. в разл. газово-плазменных системах. Образование О. и. в газовом разряде резко снижает проводимость плазмы, а это приводит к возникновению неустойчивостей и структур в газовом разряде. Введение в газовый промежуток электроотрицат. газов повышает его пробойное напряжение. Существенны процессы с О. и. в атмосфере Земли, планет, звёзд. Отриц. заряд у поверхности Земли связан с процессом 2 (табл. 4). Излучение Солнца в оптич. области спектра в большей степени создаётся процессом 3 (табл. 4), протекающим в фотосфере Солнца.

Лит.: Смирнов Б. М., Отрицательные ионы, М., 1978; Месси Г., Отрицательные ионы, пер. с англ., М., 1979.

Б. М. Смирнов.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ КРИСТАЛЛЫ — одноосные кристаллы, в к-рых скорость распространения обыкновенного луча света меньше, чем скорость распространения необыкновенного луча (см. Двойное лучепреломление, Кристаллооптика). В кристаллографии О. к. наз. также жидкие включения в кристаллах, имеющие ту же форму, что и сам кристалл.

ОТРЫВНОЕ ТЕЧЕНИЕ — течение вязкой жидкости (газа), при к-ром следующий вдоль твёрдой поверхности поток жидкости отрывается от неё. Различают неск. типов О. т.: для гладкой поверхности отрыв с последующим присоединением оторвавшегося потока к поверхности и отрыв, в к-ром это присоединение не происходит. Кроме того, следует выделить отрыв перед и после уступа на поверхности тела, О. т. над выемкой и в донной области за телом.

Необходимое условие возникновения О. т. вязкой жидкости — повышение давления в направлении течения, т. е. убывание скорости. Типичным примером такого течения при дозвуковых скоростях потока является течение у поверхности с образующими криволинейной формы (напр., у профиля крыла при больших углах атаки, сферы), в диффузоре, канале с уступом и др. При обтекании тела криволинейной формы (рис. 1) в пределах толщины δ пограничного слоя по нормали к поверхности скорость течения убывает от значения v_0 на